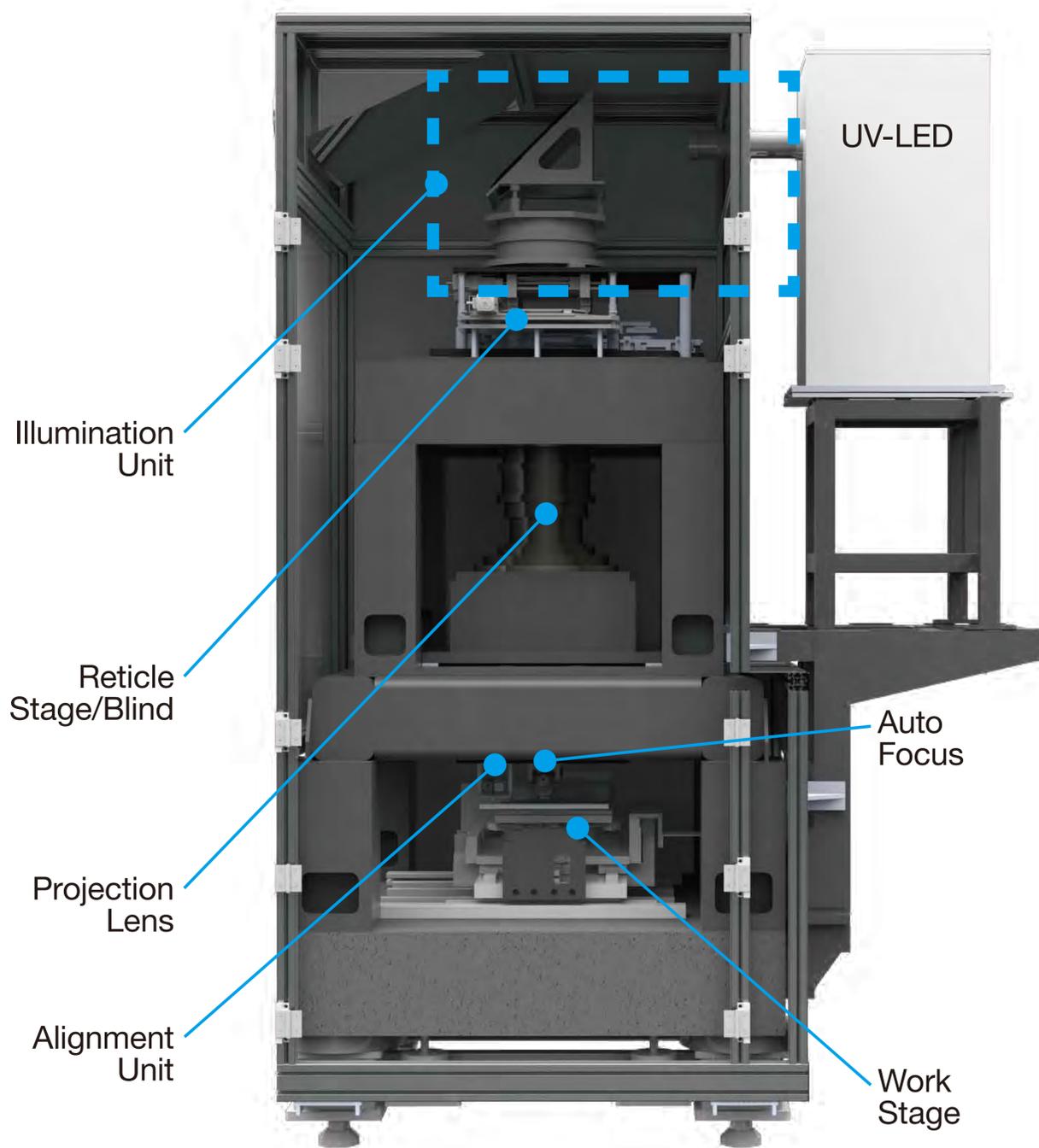


# 投影露光装置

Projection exposure system for wafer size

# MRSシリーズ



MRS1450 内部構成

## MRS特長

- 8インチ以下は「一括露光方式」、12インチは「ステップ&リピート露光方式」の選択が可能
- 露光エリアが広い為、高生産性を実現
- 焦点深度が深い為、MEMS、RFフィルター業界に多数の実績あり
- TAIKOウエハにも対応
- グローバルアライメント方式
- 高剛性フレームにより、高精度アライメント露光が実現
- フォーカスマップ機構標準装備



株式会社 サーマプレジジョン  
Cerma Precision, Inc.